

**産総研未公開特許出願情報**

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、知的財産部 技術移転室にご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研知的財産部技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo-ml(@aist.go.jp を付けてください)

2012年 12月分 (21件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
1	特願2012-243433	2012/11/5	リチウム二次電池用正極活物質	作田 敦
2	特願2012-264701	2012/12/3	熱雑音温度計及びそれに用いる基準雑音電圧発生器	山田 隆宏
3	特願2012-265457	2012/12/4	演算増幅器	大内 真一
4	特願2012-265787	2012/12/4	標的物質検出用マイクロチップ	田中 正人
5	特願2012-265817	2012/12/4	歌声合成システム、歌声合成システム用プログラム及び歌声合成方法	中野 倫靖
6	特願2012-266840	2012/12/6	太陽電池の電力配分回路	山田 隆夫
7	特願2012-267612	2012/12/6	コンピュータ断層撮影を用いた分析方法	中島 善人
8	特願2012-267630	2012/12/6	内視鏡用組織片採取装置	栗田 恒雄
9	特願2012-267679	2012/12/6	未分化幹細胞特異的標識プローブ	伊藤 弓弦
10	特願2012-269607	2012/12/10	ガス中のホルムアルデヒド濃度の決定方法	渡邊 卓朗
11	特願2012-271341	2012/12/12	半導体ウエハの加工装置	栗田 恒雄
12	特願2012-272775	2012/12/13	積層型LSIチップの絶縁膜の検査方法及び積層型LSIチップの製造方法	居村 史人
13	特願2012-275049	2012/12/17	液晶と高分子の配向相分離構造とその製造方法	垣内田 洋
14	特願2012-276601	2012/12/19	プローブアレイ	西村 良弘
15	特願2012-278580	2012/12/20	疲労判定装置、疲労判定方法、及びそのプログラム	河原 純一郎
16	特願2012-280092	2012/12/21	ノダフジ由来改変レクチン	佐藤 隆
17	特願2012-284090	2012/12/27	マイクロ電極及びマイクロ電極の製造方法	平野 悠
18	特願2012-284335	2012/12/27	項目表示装置、方法、並びに、プログラム	山本 吉伸
19	特願2012-284735	2012/12/27	多成分系酸化半導体の前駆体塗布液及び該塗布液を用いた多成分系酸化半導体膜の製造方法	福田 伸子

2012年 12月分 (21件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
20	特願2012-285734	2012/12/27	微小タンパク質の骨格構造に基づく分子ライブラリ	本田 真也
21	特願2012-286077	2012/12/27	乾式研磨法による脆弱試料薄片の作製法	大和田 朗